



Print

Mar 16, 1999

TITLE: IRON BASE AMORPHOUS METALLIC THIN STRIP AND MAGNETIC MARKER

PUBN-DATE: March 16, 1999

## INVENTOR-INFORMATION:

COUNTRY

OGASAWARA, ISAMU

INT-CL (IPC): C22 C 45/02; G08 B 13/24

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a thin type compact magnetic marker showing large Barkhausen discontinuity by regulating the cross-sectional dimension and cross section of an Fe base amorphous metallic thin strip to specified values and regulating the number of The times of torsion in a state in which stress is not applied to a specified value.

SOLUTION: The width of the cross-section of an Fe base amorphous metallic thin strip is regulated to 100 to 900  $\mu\text{m}$ , its thickness is regulated to 8 to 50  $\mu\text{m}$  and the cross-section thereof is regulated to 0.0025 to 0.03  $\text{mm}^2$ . In a state in which stress is not applied, the number of the times of torsion in the metallic thin strip per 10 cm is regulated to 0.05 to 3.5 times. The ratio of the thickness of the metallic thin strip to the width is preferably regulated to 0.015 to 0.4. The Fe base amorphous metal is an alloy contg. at least one kind among Fe, Co and Ni by  $\geq 65$  atomic % and forms amorphous single phases. The compsn. of the Fe base amorphous metal is composed of, by atom,  $\leq 35\%$  Ni and Fe, Co and Ni by 65 to 90% in total and preferably contains B, P, C, Si, Al, Ga, Zr, Nb and Ta by 10 to 35% in total. There is no problem even if W, V, Cr, Cu and Mo are contained by  $\leq 10$  atomic %.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

Go to Doc#

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-71658

(43) 公開日 平成11年(1999) 3月16日

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

C 2 2 C 45/02

C 2 2 C 45/02

A

G 0 8 B 13/24

G 0 8 B 13/24

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願平9-259595  
(22) 出願日 平成9年(1997) 9月25日  
(31) 優先権主張番号 特願平8-258170  
(32) 優先日 平8(1996) 9月30日  
(33) 優先権主張国 日本 (J P)  
(31) 優先権主張番号 特願平8-258171  
(32) 優先日 平8(1996) 9月30日  
(33) 優先権主張国 日本 (J P)  
(31) 優先権主張番号 特願平8-269610  
(32) 優先日 平8(1996) 10月11日  
(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000004503  
ユニチカ株式会社  
兵庫県尼崎市東本町1丁目50番地  
(72) 発明者 上埜 修司  
京都府宇治市宇治小椋23番地 ユニチカ株  
式会社中央研究所内  
(72) 発明者 網谷 健児  
京都府宇治市宇治小椋23番地 ユニチカ株  
式会社中央研究所内  
(72) 発明者 平野 俊幸  
京都府宇治市宇治小椋23番地 ユニチカ株  
式会社中央研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 Fe族基非晶質金属薄帯及び磁気マーカ

(57) 【要約】

【課題】 長さが10cm以下と小型でも磁気特性として大バルクハウゼン不連続を示し、かつ大バルクハウゼン不連続を示す臨界磁界が0.7(Oe)以下であるFe族基非晶質金属薄帯及びその薄帯から構成された磁気マーカを提供する。

【解決手段】 断面寸法として幅100~900 $\mu$ m、厚さ8~50 $\mu$ mであり、かつ磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有してなることを特徴とするFe族基非晶質金属薄帯。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 断面寸法として幅100～900 $\mu$ m、厚さ8～50 $\mu$ mであり、かつ磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有してなることを特徴とするFe族基非晶質金属薄帯。

【請求項2】 断面積が0.0025～0.03mm<sup>2</sup>であり、かつ磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有してなることを特徴とするFe族基非晶質金属薄帯。

【請求項3】 応力が付与されない状態での10cm当たりの捻れ回数が0.05～3.5回であり、かつ薄帯が平らに保持された状態で、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有してなることを特徴とする請求項1又は2記載のFe族基非晶質金属薄帯。

【請求項4】 0.7Oe以下の臨界磁界で、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有してなることを特徴とする請求項1又は2記載のFe族基非晶質金属薄帯。

【請求項5】 請求項1、2、3又は4記載のFe族基非晶質金属薄帯で構成されてなることを特徴とする磁気マーカー。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有し、パルス電圧発生特性に優れたFe族基非晶質金属薄帯に関するものであり、特にその薄帯から構成された盗難防止や物品監視システムに用いられる磁気マーカーに関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 溶融状態の合金を急冷することにより薄帯状、細線状、粉粒体状など種々の形状と特性を有する非晶質金属材料が得られることはよく知られている。中でも特開平1-25941号公報並びに特開平1-25932号公報により開示されたFe及びCo基の非晶質金属細線は磁気ヒステリシス曲線において、ある特定の磁界値において急速に磁化反転を生じる大バルクハウゼン不連続と呼ばれる特徴ある磁気特性を有する磁性材料として知られており、励磁磁界の変化速度に無関係に検出コイルに鋭い誘導電圧パルスを発生するパルス電圧発生素子として各種磁気マーカーや磁気センサに広く応用されている。

【0003】 一方、Fe族基非晶質金属薄帯においては、急冷凝固状態では非晶質金属細線と異なり大バルクハウゼン不連続を示さないことが知られていた。しかし、特殊な加工熱処理を加えた非晶質金属薄帯においては、大バルクハウゼン不連続を示す可能性があることも知られていた。例えば、特公平3-27958号公報には10cm当たりに4回の捻りを380℃での熱処理時

に付与されたFe系非晶質金属薄帯が、熱処理後に平らにされた状態に保持されることにより、磁気特性において大バルクハウゼン不連続を示すことが開示されている。また、欧州特許公開第762354号公報には磁場中で通電熱処理されたCo系非晶質金属薄帯が磁気特性において大バルクハウゼン不連続を示すことが開示されており、それらを用いて磁気マーカーが構成できることが記載されている。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 近年、磁気マーカーを利用した盗難防止や物品監視システムが普及するにつれて、物品に添付される磁気マーカーとして目立ちにくい構成が求められるようになり、長さが10cm以下、望ましくは7cm以下と小型で、かつ薄型の磁気マーカーを可能とする新しい軟磁性材料の出現が要望されてきた。しかし、前記したFe及びCo基の非晶質金属細線により磁気マーカーを構成した場合には、パルス発生特性の関係から線径（直径）を90 $\mu$ m以上とすることが必要であり、そのため各種フィルム材料や紙に細線がはさまれる磁気マーカーにおいて、全体の寸法が厚くなるという問題点を有していた。

【0005】 一方、本発明者らが特公平3-27958号公報に開示された幅2mm、厚さ25 $\mu$ mのFe<sub>81</sub>Si<sub>14</sub>B<sub>14</sub>C<sub>1</sub>（数字は原子%を表す。）非晶質金属薄帯を用い、10cm当たりに4回の捻りを380℃、25分間の熱処理時に付与されたFe系非晶質金属薄帯を作製したところ、次の問題点が明らかになった。すなわち、長さが10cmより長い薄帯においては、大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有するものは得られるものの、熱処理後の捻れ回数が薄帯の長さ10cm当たりに4回以上必要であり、熱処理後の非晶質金属薄帯が捻りを解いて平らに保持された状態において、大バルクハウゼン不連続を示す最小の励磁磁界の値（臨界磁界）が0.8（Oe）を超えることが判明した。そして、その臨界磁界が大きいため、0.7（Oe）以下の小さい励磁磁界においては検知コイルに誘導パルスを発生せず、各種盗難防止システムにおいて被検出特性が悪い磁気マーカーしか実現できないことが判明した。

【0006】 また、熱処理後の長さが10cm以下の薄帯については、磁気特性として大バルクハウゼン不連続を示さないことが判明した。すなわち、熱処理後の非晶質金属薄帯は、捻りを解いて平らに保持された状態において、パルス電圧発生特性が悪く、小型で、かつ薄型の磁気マーカーを構成することが出来ないという問題点が明らかになった。さらに、捻れ回数も薄帯の長さ10cm当たりに4回以上と多いために、熱処理時に薄帯の切断が頻繁に生じたり、熱処理後の薄帯をボビンに巻き取ったり、ボビンから薄帯を取り出したりする際に、強烈な捻れのため薄帯がくびれたり、よじれたりすることが頻繁に生じるという問題が明らかになった。また、有機材

料のフィルムにより熱処理後の薄帯を平らな状態に保持した磁気マーカを作製すると、Fe系非晶質金属薄帯の高い剛性のために磁気マーカが強く捻れた状態になり、取り扱い難いが困難になるという問題点や、磁気マーカが添付した物品から剥がれやすくなるという問題点も有していることが明らかになった。

【0007】また、本発明者らが欧州特許公開第762354号公報で開示された磁場中で通電熱処理技術を用いてCo系非晶質金属薄帯の熱処理を行い、その磁気特性を検討したところ、長さ10cmの薄帯の磁気特性において大バルクハウゼン不連続を示すことは示すが、大バルクハウゼン不連続を示す最小の励磁磁界の値（臨界磁界）が0.8(Oe)を超えることが判明した。そして、その薄帯の臨界磁界が大きいため、薄帯を用いて磁気マーカを構成した際に0.7(Oe)以下の小さい励磁磁界においては検知コイルに誘導パルスが発生せず、各種盗難防止システムにおいて被検出特性が悪く、実用性のある磁気マーカが提供できないことが判明した。

【0008】したがって、10cm以下の長さにおいても、磁気特性として大バルクハウゼン不連続を示し、かつ、大バルクハウゼン不連続を示す臨界磁界が小さい磁気マーカ用の非晶質金属材料や、磁気マーカを構成したときにマーカの捻れが生じ難い薄型の非晶質金属材料の開発が望まれていた。

【0009】本発明の目的は、長さが10cm以下と小型でも磁気特性として大バルクハウゼン不連続を示し、かつ大バルクハウゼン不連続を示す臨界磁界の値が0.7(Oe)以下である非晶質金属材料を提供することにある。また、本発明の他の目的は、そのような大バルクハウゼン不連続を示す非晶質金属材料から構成された薄型の小型磁気マーカを提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目的を達成すべく鋭意研究した結果、Fe族基非晶質金属薄帯において、特定の断面形状を有するものが10cm以下の長さにおいても磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有すること、そして、大バルクハウゼン不連続を示す臨界磁界も小さいものが得られること、さらには、その特性は保有する捻りが少ない薄帯の場合でも得られることを見出し、本発明を完成した。

【0011】すなわち、第1の発明は、断面寸法として幅100~900 $\mu$ m、厚さ8~50 $\mu$ mであり、かつ磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有してなることを特徴とするFe族基非晶質金属薄帯を要旨とするものである。また、第2の発明は、断面積が0.0025~0.03mm<sup>2</sup>であり、かつ磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有してなることを特徴とするFe族基非晶質金属薄帯を要旨とするものである。さら

に、第3の発明は、応力が付与されない状態での10cm当たりの捻れ回数が0.05~3.5回であり、かつ薄帯が平らに保持された状態で、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有してなることを特徴とする前記1又は2記載のFe族基非晶質金属薄帯を要旨とするものである。さらにまた、第4の発明は、0.7Oe以下の臨界磁界で、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有してなることを特徴とする前記1又は2記載のFe族基非晶質金属薄帯を要旨とするものである。さらにまた、第5の発明は、前記1、2、3又は4記載のFe族基非晶質金属薄帯で構成されてなることを特徴とする磁気マーカを要旨とするものである。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ、本発明を具体的に説明する。本発明の非晶質金属薄帯は、X線回折実験により確認される非晶質構造を有することが必要であるが、平らな状態に保持された状態で、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性が得られる限りにおいては結晶質相が若干含まれていてもよい。

【0013】本発明においては、非晶質金属薄帯の幅が100~900 $\mu$ mであることが必要である。薄帯の幅が900 $\mu$ m以下になることにより、長さが10cm以下の場合でも、励磁磁界が0.7Oe（エルステッド）以下において、大バルクハウゼン不連続を示す（すなわち、臨界磁界が0.7Oe以下の大バルクハウゼン不連続を示す）ものである。そして、有機材料からなるフィルム又は紙に本発明の薄帯が挟まれた構造からなる磁気マーカを構成しても、大バルクハウゼン不連続に伴う、大きな電圧値と高次の高調波成分を持つ鋭い誘導パルスを発生させることができるという利点を有する。また、熱処理後により小さな臨界磁界の大バルクハウゼン不連続を示す非晶質金属薄帯を得るためや、熱処理の際10cm当たり2回以下の捻り回数において大バルクハウゼン不連続を持つ磁気特性を得るためには幅が150~800 $\mu$ mであることが好ましい。さらに本発明においては、より長さ短く小型な薄帯において臨界磁界が小さな大バルクハウゼン不連続を持つ磁気特性を得るためには幅が150~700 $\mu$ mであることが好ましい。

【0014】ここで、幅が900 $\mu$ mより広くなると、大バルクハウゼン不連続を示すものでも臨界磁界の値が大きくなる傾向を示したり、熱処理時に10cm当たり付与する捻り回数や熱処理温度、熱処理時間を種々変更させて熱処理を行っても熱処理後の長さが10cm以下の薄帯については大バルクハウゼン不連続を示さないようになる。また、幅が100 $\mu$ m未満の薄帯は、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性が得られても、誘導されるパルスの電圧が低くなるという問題点が発生する。なお、本発明の非晶質

処理後に大バレルハウゼン特性を示しても発生するパルス電圧が低くなり、実用性に乏しくなる。また、断面積が $0.03\text{ mm}^2$ を超えると、種々の条件で熱処理を施しても、熱処理後の長さが $10\text{ cm}$ 以下の薄帯については、大バレルハウゼン不連続を示さないくなる。

【0019】本発明における薄帯のねじれ回数とは、360°回転で1回と数えるものとし、応力を付与しない状態で長さ1 m当たりのねじれ回数あるいはねじれ角度を測定し、10 cm当たりのねじれ回数を算出するものとする。

そして、本発明において、大バルクハウゼン不連続特性を付与するために捻り熱処理により処理された薄帯においては、前述した幅、厚み、断面積などが本発明の独特の断面形状を満足するとともに、ねじれ回数が0.05以上3.5以下であることが好ましい。また、より臨界磁界の安定した大バルクハウゼン不連続特性を得るには熱処理後の薄帯のねじれ回数が0.1回以上3回以下であることがより好ましい。ここで薄帯10cm当たりのねじれ回数が0.05回未満になると、薄帯が平らに保持された状態において大バルクハウゼン不連続を示すために必要な薄帯の長さが長くなる傾向が認められる。また、ねじれ回数が3.5回より多くなると磁気特性として大バルクハウゼン不連続を示しても、磁気マーカを作製するためにねじれを解除し平面上に薄帯を固定した場合に、臨界磁界が高くなったり、高い剛性のため、磁気マーカが強くねじれた状態になり、取り扱いが困難になる。

【0020】本発明のFe族基非晶質金属薄帯においては、Fe、Co及びNiの少なくとも1種を65原子%以上含む合金であり、非晶質単相を形成するものであれば特に組成の限定はない。しかし、Niが35原子%以下の範囲で、Fe、Co及びNiから選ばれた1種又は2種以上のFe族基の元素の合計が65原子%以上90原子%以下で、非晶質形成を促進する元素として、B、P、C、Si、Al、Ga、Zr、Nb及びTaの群から選ばれた1種又は2種以上の元素を合計で10原子%以上35原子%以下含む合金あることが望ましい。さらに本発明においては、合金組成に耐食性を改善する目的でW、V、Cr、Cu及びMoが10原子%以下含まれていても磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性を有するものであれば特に問題はない。

【0021】本発明においてFe族基の元素の合計含有量が65原子%未満になると磁気特性が劣化し、室温における磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示さなくなる傾向がある。また、Fe族基の元素の合計含有量が90原子%を越える場合や、非晶質形成を促進する元素の合計が10原子%未満か35原子%を越える場合になると、非晶質形成能が低下し非晶質単相を形成しにくくなり、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す非晶質金属薄層が得られ

にくくなる。

【0022】また、本発明の非晶質金属薄帯は、長さが10cm以下において、磁気ヒステリシス曲線上で図4～5に示すように、ある特定の励磁磁界値（以下、臨界磁界値と称す）において急速に磁化反転を生じる大バルクハウゼン不連続を示すものであり、その急峻な磁化反転において材料の飽和磁化（飽和磁束密度）の30%以上の磁化変化量を伴うものである。さらに、磁気マーカへの応用を考慮する場合、長さが7cm以下で大バルクハウゼン不連続を示すものが好ましい。

【0023】また、本発明の非晶質金属薄帯は、大バルクハウゼン不連続に伴う磁化反転が生じる臨界磁界値としては、0.7(Oe)以下であることが望まれる。さらに、磁気マーカ用の磁性材料としては、臨界磁界の値が0.6(Oe)以下であることがさらに好ましく、特に、0.05～0.5(Oe)であることが最も好ましい。ここで、大バルクハウゼン不連続の臨界磁界値が0.7(Oe)を越えると、磁気マーカを構成した際、マーカの被検出特性が悪くなり実用性が低下する傾向がある。

【0024】なお、本発明の非晶質金属薄帯は交番磁界中で大バルクハウゼン不連続に伴う波形の鋭い誘導電圧パルスが発生する。また、発生するパルス電圧の高調波成分も高次の成分まで十分高い振幅で得られるものである。そのため、本発明の非晶質金属薄帯はパルス電圧発生素子として各種磁気マーカや磁気センサーに広く用いることができる磁性材料である。

【0025】本発明の磁気マーカは、前記の非晶質金属薄帯をパルス発生用素子として用いることが必要である。そして、マーカ構成としては種々の形態をとることができる。例えば、図6は代表的な磁気マーカの構成を示しているが、本発明では非晶質金属薄帯がよりを解除された状態（平らな状態）に保持されていることが望ましい。図中の非晶質金属薄帯1は、粘着剤が塗布された基材フィルム2上に所定の長さに切断されて配置されている。そして、薄帯の上方から粘着剤が塗布された基材フィルム3で挟み込まれている。ここで、薄帯を平ら状態で挟み込む基材としては、ポリエチレンテレフタレートや紙など、各種有機材料からなるものを用いることができる。また、基材の厚さとしては、0.5～200μmの種々のものを用いることができ、目的に応じて2種以上の材料からなる基材を用いることも可能である。なお、物品監視等に用いられる磁気マーカにおいては、被検出物にマーカが接着させる必要があるが、そのような場合には基材フィルムの裏面に（図では見えない）粘着剤付きのものを用いればよい。

【0026】また、磁気マーカとして、マーカ特性を示さない状態（失活状態と以下称す）とマーカ特性を示す状態の2種類の状態をとりうるようにするためには、保磁力が30(Oe)を越えるような半硬質磁性材料を非

晶質金属薄帯とともに用いればよい。例えば、図7は、失活状態をとり得る本発明の磁気マーカの一例の実施態様を模式図で示している。図7において、半硬質磁性材料4は複数の小片の形で非晶質金属薄帯1の回りに配置されている。このような磁気マーカは、外部から50(Oe)を越えるような磁界を与えることにより、半硬質磁性材料4が着磁され、非晶質金属薄帯4はバイアス磁界下にさらされる。そのため、その後、磁気マーカが外部の交番磁界中に置かれた場合でも、顕著なパルス電圧を発生しない失活状態に保たれることになる。

【0027】本発明のFe族基非晶質金属薄帯は、前述の独特の断面寸法を有するように液体急冷法により作製された後に、熱処理されることにより製造される。液体急冷法としては、本発明の断面形態を有する非晶質金属薄帯が得られる方法であれば、特に製造方法については限定されないが、従来より液体急冷法として知られている融液抽出法、遠心急冷法、単ロール法あるいは双ロール法を用いて作製することが好ましい。例えば、液体急冷法として単ロール法を利用する場合、先端に孔を有するセラミックス製ノズル中で合金を溶融し、回転している銅ロールに溶融合金をノズル孔から噴出させ、急冷凝固させることにより本発明の非晶質金属薄帯を製造することができ、代表的な製造条件としては、断面積が0.2mm<sup>2</sup>以下のノズル孔を有するセラミックス製のノズルを用い、5～50m/sの周速度で回転する銅ロール上に、大気中、真空中あるいはアルゴン等の不活性ガス雰囲気中でノズル孔から溶融合金を0.005kg/cm<sup>2</sup>以上の圧力で噴出させればよい。また、液体急冷法により広幅の非晶質金属薄帯を製造し、その薄帯から機械的裁断方法（スリット）により細幅の非晶質金属薄帯を製造する方法でも本発明の断面形態を有する非晶質金属薄帯が得られれば特に問題はない。

【0028】本発明に係わる非晶質金属薄帯の熱処理方法としては、熱処理後に磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す非晶質金属薄帯が得られる方法であれば特に限定されないが、本発明の薄帯に好ましい熱処理方法としては、ほとんど捻りや張力を付与しない状態で、250℃以上結晶化温度以下の温度範囲において、0.1～100000秒の間で熱処理を行う方法や、薄帯の長さ10cm当たりの捻回数として0.05～3.5回の捻りを付与した状態で250℃以上結晶化温度以下の温度範囲において、0.1～100000秒の間で熱処理を行う方法や、薄帯の長さ10cm当たりの捻回数として0.05～3.5回の捻りを付与し、さらに薄帯の長手方向に0.05～130kg/mm<sup>2</sup>の張力をも付与した状態で、250℃以上結晶化温度以下の温度範囲において、0.1～100000秒の間で熱処理を行う方法などが挙げられる。

【0029】また、前述の熱処理方法以外の方法としては、本発明に係わる独特の断面形状を有する非晶質金属

薄帯を用いて、熱処理時に通電を行う方法や熱処理時に磁場を印加しさらに通電を行う熱処理方法を用いても、良好な大バルクハウゼン不連続特性を有する本発明の薄帯が製造される。中でも小さな臨界磁界を有する大バルクハウゼン不連続特性を実現させるための熱処理条件としては、200℃以上結晶化温度以下の温度範囲において、0.01~20Aの大きさの直流あるいは交流電流を薄帯の長手方向に通電する方法や、0.05~20(Oe)の直流あるいは交番磁場中で0.01~20Aの大きさの直流あるいは交流電流を薄帯の長手方向に通電する方法を採用することができる。

#### 【0030】

【実施例】次に、実施例及び比較例により本発明を具体的に説明する。

#### 実施例1~13、比較例1~9

表1に示す各種組成からなる合金について、単ロール法を用いて急冷薄帯を作製した。なお、単ロール法においては、アルゴン雰囲気下で直径80~900 $\mu$ mのノズル孔を備える石英ノズル中で表1の各種合金を溶融させ、1000~4500rpmで回転する直径20cmの銅ロール上に、溶湯をアルゴンガス噴出圧0.5~4kg/cm<sup>2</sup>で噴出することにより、急冷金属薄帯を作製した。このときの石英ノズルと回転冷却ロール面との距離は1mm以下であった。次に、作製した急冷薄帯を380℃において、10cm当たり0.5回の捻りを\*

\*付与した状態で25分間の熱処理を行った。

【0031】作製したこれらの薄帯の組織、幅、厚さ、パルス電圧及び磁気ヒステリシス曲線における大バルクハウゼン不連続の有無を測定した。その結果を表1に示す。ここで組織については、X線回折法により非晶質相特有のハローパターンが得られた状態を非晶質と判定し、非晶質と結晶質が混在する状態を結晶質と判定した。また、断面を光学顕微鏡(OPTIPHOT, ニコン社製)により10点観察し、10断面の平均値として幅と厚さを算出した。そして、その平均値を用いて厚さ(t)の幅(w)に対する比(t/w)を算出した。さらに、磁気特性については、平らな状態に保持した試料長20cmの薄帯を用いて、励磁磁界0.01~1(Oe)、周波数60Hzにおいて交流磁気ヒステリシス曲線を測定することにより、大バルクハウゼン不連続の有無や大バルクハウゼン不連続の生じる臨界磁界値を判定した。さらにまた、作製された非晶質金属薄帯のパルス電圧発生特性は、周波数50Hz、印加最大磁界1(Oe)の正弦波で薄帯を励磁し、非晶質金属薄帯中央部の周囲に巻かれた長さ3.5cm、590ターン、内径3cmの検出コイルにて検出されるパルス電圧を測定した。

#### 【0032】

#### 【表1】

	組成 [原子%]	組織	厚さ [ $\mu$ m]	幅 [ $\mu$ m]	厚さと 幅との比	大バルクハウゼン 不連続の有無	臨界磁界 (Oe)	検出パルス 電圧(mV)
実施例1	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	非晶質	35	652	0.054	有り	0.38	85
実施例2	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	非晶質	16	800	0.020	有り	0.33	79
実施例3	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	非晶質	43	295	0.145	有り	0.39	78
実施例4	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	非晶質	15	728	0.021	有り	0.37	73
実施例5	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	非晶質	44	150	0.293	有り	0.33	71
実施例6	Fe <sub>77</sub> Co <sub>11</sub> Si <sub>12</sub> B <sub>2</sub>	非晶質	25	610	0.041	有り	0.34	82
実施例7	Fe <sub>78</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>12</sub> B <sub>2</sub>	非晶質	28	615	0.046	有り	0.35	76
実施例8	Fe <sub>80</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>7</sub> B <sub>3</sub>	非晶質	33	605	0.055	有り	0.38	72
実施例9	Fe <sub>80</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>7</sub> B <sub>3</sub>	非晶質	32	618	0.052	有り	0.32	73
実施例10	Fe <sub>80</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>7</sub> B <sub>3</sub>	非晶質	31	620	0.050	有り	0.36	71
実施例11	Co <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	非晶質	33	605	0.055	有り	0.38	73
実施例12	Fe <sub>78</sub> P <sub>12</sub> Cr <sub>10</sub> Mo <sub>2</sub>	非晶質	31	620	0.050	有り	0.36	71
実施例13	Fe <sub>80</sub> Zr <sub>7</sub> B <sub>7</sub> Cu <sub>4</sub> Mo <sub>2</sub>	非晶質	33	605	0.055	有り	0.38	72
比較例1	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	非晶質	25	1050	0.024	無し	—	56
比較例2	Fe <sub>81</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>1</sub> C <sub>1</sub>	非晶質	25	2000	0.013	無し	—	45
比較例3	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	非晶質	35	98	0.357	有り	0.32	38
比較例4	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	非晶質	7	330	0.021	有り	0.36	25
比較例5	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	結晶質	65	239	0.27	無し	—	12
比較例6	Fe <sub>78</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>4</sub>	結晶質	55	98	0.561	無し	—	13
比較例7	Fe <sub>78</sub> Co <sub>10</sub> Cr <sub>10</sub> Si <sub>12</sub> B <sub>2</sub>	非晶質	32	302	0.106	無し	—	—
比較例8	Fe <sub>80</sub> Cr <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>2</sub>	非晶質	22	252	0.084	無し	—	—
比較例9	Fe <sub>80</sub> Si <sub>18</sub> B <sub>2</sub>	結晶質	18	289	0.062	無し	—	12

\*検出されず。

【0033】表1に示すように、本発明のFe族基非晶質薄帯は、本発明の独特の断面形状を反映して、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示

※し、かつ磁化反転時の臨界磁界値もいずれも0.5(Oe)未満の磁気特性が得られていた。そのため、検出コイルに発生する誘導パルスも波形の鋭いパルスであり、

いずれも70mV以上の優れたパルス電圧発生特性を有し、被検出特性に優れていることが明らかである。

【0034】しかしながら、比較例1及び2に示すように幅が900 $\mu$ mを超えるか、又は厚さの幅に対する比が0.015未満の断面を有する薄帯は熱処理時に10cm当りに1回の捻りを付与された状態では、非晶質構造であっても磁気特性において大バルクハウゼン不連続を示さず、発生するパルス電圧も実施例1～13に比べて格段に低いものになっていた。また、比較例3及び4のように幅が100 $\mu$ m未満か、厚さが8 $\mu$ m未満の場合、非晶質構造であり、大バルクハウゼン不連続を示してもパルス電圧が低いため、磁気マーカなどへの実用性は低いものであった。さらに、比較例5及び6のように厚みが45 $\mu$ mを超えるか、又は厚さの幅に対する比が0.4を超える断面形状を有する薄帯は、製造時に\*

\*急冷効果が十分でなく非晶質構造が得られず、磁気特性において大バルクハウゼン不連続も示さなかった。さらにまた、比較例7及び8はFe族元素の合計含有量がいずれも65原子%未満であり、非晶質構造であっても非磁性薄帯のため、パルス電圧が検出されなかった。さらにまた、比較例9は非晶質形成を促進する元素の含有量が多すぎるため、かえって非晶質構造が形成できず、大バルクハウゼン不連続を示さず発生するパルス電圧も非常に低いものであった。

#### 【0035】実施例14～26

実施例1～13のそれぞれの薄帯を長さ10cmにする以外は、実施例1と同様にして断面形状及び磁気特性を検討した。その結果を表2に示す。

#### 【0036】

#### 【表2】

組成 【原子%】	組織	厚さ 【 $\mu$ m】	幅 【 $\mu$ m】	厚さと 幅との比	大バルクハウゼン 不連続の有無	臨界磁界 (Oe)	検出パルス 電圧(mV)
実施例14 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	35	652	0.054	有り	0.36	84
実施例15 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	18	800	0.020	有り	0.32	77
実施例16 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	43	295	0.146	有り	0.37	77
実施例17 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	15	728	0.021	有り	0.35	72
実施例18 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	44	150	0.293	有り	0.32	70
実施例19 Fe <sub>67</sub> Co <sub>11</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	25	610	0.041	有り	0.32	80
実施例20 Fe <sub>65</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	28	615	0.046	有り	0.33	75
実施例21 Fe <sub>60</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	605	0.055	有り	0.35	72
実施例22 Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	32	618	0.052	有り	0.31	71
実施例23 Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	31	620	0.050	有り	0.35	71
実施例24 Co <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	605	0.055	有り	0.37	73
実施例25 Fe <sub>70</sub> P <sub>10</sub> Cr <sub>10</sub> Mo <sub>10</sub>	非晶質	31	620	0.050	有り	0.33	72
実施例26 Fe <sub>60</sub> Zr <sub>10</sub> B <sub>10</sub> Cu <sub>10</sub> Nb <sub>10</sub>	非晶質	33	605	0.055	有り	0.35	71

【0037】表2に示すように、本発明のFe族基非晶質薄帯は長さが10cmになった場合でも、本発明の独特の断面形状を反映して、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示し、かつ磁化反転時の臨界磁界値も長さが20cmの場合とほとんど変わらず、いずれも0.5(Oe)未満の磁気特性が得られていた。そのため、検出コイルに発生する誘導パルスも波形の鋭いパルスであり、いずれも70mV以上の優れたパルス電圧発生特性を有し、被検出特性に優れていることが明らかである。

※

#### ※【0038】実施例27～39、比較例10～13

表3に示す各種組成からなる合金について、実施例1と同様に単ロール法を用いて急冷薄帯を作製し熱処理を施した。作製したこれらの薄帯の組織、幅、厚さ、断面積、パルス電圧及び磁気ヒステリシス曲線における大バルクハウゼン不連続の有無、臨界磁界の大きさを実施例1と同様に測定した。その結果を表3に示す。

#### 【0039】

#### 【表3】



13

14

	組成 【原子%】	組織	厚さ 【μm】	幅 【μm】	断面積 【mm <sup>2</sup> 】	大バルクハウゼン 不連続の有無	臨界磁界 (Oe)	検出パルス 電圧(mV)
実施例27	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	37	280	0.0088	有り	0.38	85
実施例28	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	41	260	0.0095	有り	0.33	79
実施例29	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	786	0.0300	有り	0.39	78
実施例30	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	15	700	0.0089	有り	0.37	73
実施例31	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	150	0.0057	有り	0.33	71
実施例32	Fe <sub>70</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	32	296	0.0081	有り	0.34	82
実施例33	Fe <sub>70</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	28	310	0.0074	有り	0.35	76
実施例34	Fe <sub>70</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	345	0.0097	有り	0.38	72
実施例35	Fe <sub>70</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	35	288	0.0096	有り	0.32	73
実施例36	Fe <sub>70</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	460	0.0197	有り	0.36	71
実施例37	Co <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> Al <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	36	285	0.0097	有り	0.31	72
実施例38	Fe <sub>70</sub> P <sub>10</sub> Cr <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	31	315	0.0093	有り	0.34	85
実施例39	Fe <sub>70</sub> Zr <sub>10</sub> B <sub>10</sub> Cu <sub>10</sub> Nb <sub>10</sub>	非晶質	26	327	0.0072	有り	0.35	74
比較例10	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	25	1050	0.0223	無し	---	56
比較例11	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	18	2000	0.0425	無し	---	45
比較例12	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	25	98	0.0029	有り	0.31	36
比較例13	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	7	330	0.0021	有り	0.34	26

【0040】表3に示すように、本発明の実施例27～39のFe族基非晶質薄帯は本発明の独特の断面形状を反映して、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性が得られており、その大バルクハウゼン不連続の臨界磁界もいずれも0.5(Oe)未満の良好なものとなっていた。そして、検出コイルに発生する誘導パルスも波形の鋭いパルスであり、いずれも70mV以上の優れたパルス電圧発生特性を有していることが明らかである。

【0041】しかしながら、比較例10及び11に示すように幅が900μmを越えるか、又は断面積が0.03mm<sup>2</sup>を越える断面を有する薄帯は、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性\*30

\*が得られず、発生するパルス電圧も実施例27～39に比べて格段に低いものになっていた。また、比較例12及び13のように幅が100μm未満か、厚さが8μm未満の場合あるいは断面積が0.0025mm<sup>2</sup>未満の場合は、非晶質構造であり、大バルクハウゼン不連続を示してもパルス電圧が低いため、磁気マーカなどへの実用性は低いものであった。

【0042】実施例40～52

実施例27～39のそれぞれの薄帯を長さ10cmにする以外は、実施例27と同様にして断面形状及び磁気特性を検討した。その結果を表4に示す。

【0043】

【表4】

	組成 【原子%】	組織	厚さ 【μm】	幅 【μm】	断面積 【mm <sup>2</sup> 】	大バルクハウゼン 不連続の有無	臨界磁界 (Oe)	検出パルス 電圧(mV)
実施例40	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	37	280	0.0088	有り	0.38	82
実施例41	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	41	260	0.0095	有り	0.31	76
実施例42	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	786	0.0300	有り	0.36	77
実施例43	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	15	700	0.0089	有り	0.35	73
実施例44	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	150	0.0057	有り	0.33	72
実施例45	Fe <sub>70</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	32	296	0.0081	有り	0.32	80
実施例46	Fe <sub>70</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	28	310	0.0074	有り	0.34	75
実施例47	Fe <sub>70</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	345	0.0097	有り	0.37	72
実施例48	Fe <sub>70</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	35	288	0.0096	有り	0.31	73
実施例49	Fe <sub>70</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	460	0.0197	有り	0.35	71
実施例50	Co <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> Al <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	36	285	0.0097	有り	0.31	73
実施例51	Fe <sub>70</sub> P <sub>10</sub> Cr <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	31	315	0.0093	有り	0.33	84
実施例52	Fe <sub>70</sub> Zr <sub>10</sub> B <sub>10</sub> Cu <sub>10</sub> Nb <sub>10</sub>	非晶質	26	327	0.0072	有り	0.34	73

【0044】表4に示すように、本発明のFe族基非晶質薄帯は長さ10cmになった場合でも、本発明の独特の断面形状を反映して、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示し、かつ磁化反転時の臨界磁界値も長さが20cmの場合とほとんど変わらず、いずれも0.5(Oe)未満の磁気特性が得られていた。そのため、検出コイルに発生する誘導パルスも波形※50

※の鋭いパルスであり、いずれも70mV以上の優れたパルス電圧発生特性を有し、被検出特性に優れていることが明らかである。

【0045】実施例53～57

表5に示す各種組成からなる合金について、実施例1と同様に単ロール法を用いて急冷薄帯を作製し熱処理を施した。作製したこれらの薄帯について組織、幅、厚さ、

断面積、パルス電圧及び磁気ヒステリシス曲線における大バルクハウゼン不連続の有無、臨界磁界の大きさを長さ7cmの薄帯について実施例1と同様に測定した。そ\*

\*の結果を表5に示す。

【0046】

【表5】

組成 【原子%】	組織	長さ 【μm】	幅 【μm】	厚さと幅 の比 b/a	断面積 【mm <sup>2</sup> 】	大バルクハウゼン 不連続の有無	臨界磁界 【Oe】	検出パルス 電圧(mV)
実施例53 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	35	690	0.051	0.030	有り	0.31	85
実施例54 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	290	0.181	0.011	有り	0.36	78
実施例55 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	150	0.300	0.006	有り	0.39	71
実施例56 Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	605	0.055	0.017	有り	0.32	72
実施例57 Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	32	618	0.052	0.018	有り	0.30	73

【0047】表5に示すように、本発明のFe族基非晶質薄帯は長さが7cmになった場合でも、本発明の独特の断面形状を反映して、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示し、かつ磁化反転時の臨界磁界値もいずれも0.5(Oe)未満の磁気特性が得られていた。そのため、検出コイルに発生する誘導パルスも波形の鋭いパルスであり、いずれも70mV以上の優れたパルス電圧発生特性を有し、被検出特性に優れていることが明らかである。

【0048】実施例58～83

実施例1～13及び27～39で使用した薄帯を用いて長さ8.5cmに切断し磁気マーカ用のパルス発生用磁性体とした。そして、これらを粘着剤が塗布された厚さ25μm、幅5mmのポリエチレンテレフタレート基材フィルムを用いて挟み込み、図6に示した構造の長さ※

※9cmの磁気マーカを作製した。ここで薄帯はよりが解除された状態(平らな状態)に保持されるようになっている。そして、作製したそれぞれの磁気マーカについて、励磁磁界0.01～1(Oe)、周波数60Hzにおいて交流磁気ヒステリシス曲線を測定することにより、大バルクハウゼン不連続の有無を判定した。さらに作製された磁気マーカのパルス電圧発生特性は、周波数50Hz、印加最大磁界1(Oe)の正弦波でマーカを励磁し、マーカの周囲に巻かれた長さ3.5cm、590ターン、内径3cmの検出コイルにて検出されるパルス電圧を測定した。各種の測定結果を表6と表7に併せて示す。

【0049】

【表6】

	組成 【原子%】	組織	長さ 【μm】	幅 【μm】	長さ と幅との比	大ΔH/AΔTの 不連続の有無	臨界磁界 (Oe)	検出パルス 電圧(mV)
実施例58	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	35	652	0.054	有り	0.35	80
実施例59	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	16	800	0.020	有り	0.30	75
実施例60	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	43	295	0.146	有り	0.34	74
実施例61	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	15	728	0.021	有り	0.34	73
実施例62	Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	44	150	0.293	有り	0.31	71
実施例63	Fe <sub>67</sub> Co <sub>11</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	25	610	0.041	有り	0.30	78
実施例64	Fe <sub>61</sub> Co <sub>16</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	28	615	0.046	有り	0.31	74
実施例65	Fe <sub>60</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	605	0.055	有り	0.34	71
実施例66	Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	618	0.052	有り	0.28	71
実施例67	Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	31	620	0.050	有り	0.31	72
実施例68	Co <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	605	0.055	有り	0.33	74
実施例69	Fe <sub>70</sub> P <sub>10</sub> Cr <sub>10</sub> Mo <sub>10</sub>	非晶質	31	620	0.050	有り	0.34	71
実施例70	Fe <sub>60</sub> Zr <sub>10</sub> B <sub>10</sub> Cu <sub>10</sub> Nb <sub>10</sub>	非晶質	33	605	0.055	有り	0.32	71

【0050】

★ ★【表7】

組成 【原子%】	組織	長さ 【μm】	幅 【μm】	断面積 【mm <sup>2</sup> 】	大バルクハウゼン 不連続の有無	臨界磁界 【Oe】	検出パルス 電圧(mV)
実施例71 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	37	280	0.0088	有り	0.34	81
実施例72 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	41	260	0.0095	有り	0.30	78
実施例73 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	788	0.0300	有り	0.33	76
実施例74 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	15	700	0.0089	有り	0.31	72
実施例75 Fe <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	150	0.0057	有り	0.30	72
実施例76 Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	32	296	0.0081	有り	0.29	78
実施例77 Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	28	310	0.0074	有り	0.33	74
実施例78 Fe <sub>60</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	345	0.0097	有り	0.35	73
実施例79 Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	35	288	0.0086	有り	0.31	74
実施例80 Fe <sub>60</sub> Co <sub>10</sub> Ni <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	460	0.0197	有り	0.34	71
実施例81 Co <sub>70</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	36	285	0.0097	有り	0.30	72
実施例82 Fe <sub>70</sub> P <sub>10</sub> Cr <sub>10</sub> Mo <sub>10</sub>	非晶質	31	315	0.0093	有り	0.33	80
実施例83 Fe <sub>60</sub> Zr <sub>10</sub> B <sub>10</sub> Cu <sub>10</sub> Nb <sub>10</sub>	非晶質	26	327	0.0072	有り	0.33	71

17

【0051】表6及び7に示すように、本発明の実施例58～83の磁気マーカは、本発明の独特の断面形状を有する薄帯を用いていることを反映して、長さが9cm以下でも磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性が得られていた。そのため、検出コイルに発生する誘導パルスも波形の鋭いパルスであり、いずれも70mV以上の優れたパルス電圧発生特性を有していた。また、各マーカの大バルクハウゼン不連続を生じる磁界（臨界磁界）は表6及び7より明らかなようにいずれも0.5(Oe)以下であった。

【0052】実施例84～93、比較例14～16

10 【0053】

\* 【表8】

組成 [原子%]	組織	長さ [μm]	幅 [μm]	長さ×幅 の比 L/W	断面積 [mm <sup>2</sup> ]	ねじれ回数 (回/10cm)	大バルクハウゼン 不連続の有無	検出パルス 電圧(mV)
実施例84 Fe <sub>80</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	37	650	0.057	0.0187	1	有り	85
実施例85 Fe <sub>80</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	18	800	0.023	0.0131	1.2	有り	79
実施例86 Fe <sub>80</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	12	500	0.024	0.0051	0.5	有り	78
実施例87 Fe <sub>80</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	18	700	0.021	0.0083	1.5	有り	73
実施例88 Fe <sub>80</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	150	0.300	0.0052	0.1	有り	71
実施例89 Fe <sub>80</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	25	610	0.041	0.0118	1	有り	83
実施例90 Fe <sub>80</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	35	848	0.041	0.0239	3	有り	76
実施例91 Fe <sub>80</sub> Al <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	33	604	0.055	0.0160	1	有り	72
実施例92 Fe <sub>80</sub> Co <sub>10</sub> Al <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	32	620	0.052	0.0159	1	有り	73
実施例93 Fe <sub>80</sub> P <sub>10</sub> Co <sub>10</sub>	非晶質	32	615	0.052	0.0141	1	有り	85
比較例14 Fe <sub>80</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	25	1750	0.014	0.0351	0.5	無し	58
比較例15 Fe <sub>80</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	25	1750	0.014	0.0351	3	無し	45
比較例16 Fe <sub>80</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	25	1750	0.014	0.0351	1	無し	26

【0054】表8に示すように、本発明の実施例84～93のFe族基非晶質薄帯は本発明の独特の断面形状を反映して薄帯のねじれ回数が0.1～3回/10cmで、磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性が得られていた。そのため、検出コイルに発生する誘導パルスも波形の鋭いパルスであり、いずれも70mV以上の優れたパルス電圧発生特性を有していた。また、実施例84～93のFe族基非晶質薄帯の大バルクハウゼン不連続を生じる磁界（臨界磁界）は0.2～0.5(Oe)であった。しかしながら、比較例14～16に示すように、幅に対する比が0.015未満の断面か、断面積が0.03mm<sup>2</sup>を越える断面寸法を有する薄帯は、ねじれ回数が0.5～3回/10cmであっても磁気特性において大バルクハウゼン不連続を示さず、発生するパルス電圧も実施例84～93に比べて格段に低いものになった。このように、本発明のFe族基非晶質金属薄帯は、特定の断面形態を有する薄帯※

※が特定のねじれ回数を有するように熱処理されているため、平らに保持された状態において臨界磁界が0.5(Oe)以下の大バルクハウゼン不連続を示すものであり、磁気マーカ用のパルス発生素子として優れた特性を備えている。

30 【0055】実施例94～96

表9に示す各種組成からなる合金について、実施例1と同様に単ロール法を用いて急冷薄帯を作製した。そして、340℃において、捻りを付与しない状態で10分間の熱処理を施した。次に作製したこれらの薄帯について組織、幅、厚さ、断面積、パルス電圧及び磁気ヒステリシス曲線における大バルクハウゼン不連続の有無、臨界磁界の大きさを長さ10cmの薄帯について実施例1と同様に測定した。その結果を表9に示す。

【0056】

40 【表9】

組成 [原子%]	組織	長さ [μm]	幅 [μm]	長さ×幅 の比 L/W	断面積 [mm <sup>2</sup> ]	大バルクハウゼン 不連続の有無	臨界磁界 (Oe)	検出パルス 電圧(mV)
実施例94 Fe <sub>80</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	35	305	0.115	0.010	有り	0.16	71
実施例95 Fe <sub>80</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	45	280	0.161	0.012	有り	0.15	72
実施例96 Fe <sub>80</sub> Co <sub>10</sub> Si <sub>10</sub> B <sub>10</sub>	非晶質	25	250	0.140	0.007	有り	0.12	71

【0057】表9に示すように、本発明の実施例94～96のFeFe族基非晶質薄帯は本発明の独特の断面形状を反映して熱処理時にねじりが付与されない状態でも、

★磁気ヒステリシス曲線において大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性が得られていた。そのため、検出コイルに発生する誘導パルスも波形の鋭いパルスであり、いず

★50

19

れも70mV以上の優れたパルス電圧発生特性を有していた。また、大バルクハウゼン不連続を生じる磁界（臨界磁界）は0.2(Oe)以下であった。また、実施例94～96の薄帯は長さが7cmにおいても、磁気ヒステリシス曲線において臨界磁界が0.7(Oe)以下の大バルクハウゼン不連続を示す磁気特性が得られることが確認された。このように、本発明のFe族基非晶質金属薄帯は、特定の断面形態を有する薄帯が特定の条件下で熱処理されているため、熱処理後にねじれを保有しない薄帯においても臨界磁界が0.7(Oe)以下の大バ

【0058】

【発明の効果】本発明の非晶質金属薄帯は、長さが10cm以下においても、臨界磁界の値が0.7(Oe)以下の大バルクハウゼン不連続を示すものであり、交番磁界中におかれた場合、検出コイルに優れたパルス電圧発生特性を示す。また、薄帯のねじれ回数も少ないため、扱いやすく、有機材料のフィルム等により薄帯を平らな状態に保持した磁気マーカを作製した場合でも、磁気マ

10

20

20

として種々のセンサー素子への応用が可能な工業材料である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のFe族基非晶質金属薄帯の断面形状の一例を示す概略斜視図である。

【図2】本発明のFe族基非晶質金属薄帯の断面形状の別の例を示す概略斜視図である。

【図3】本発明のFe族基非晶質金属薄帯の断面形状のさらに別の例を示す概略斜視図である。

【図4】本発明のFe族基非晶質金属薄帯において、臨界値より小さな励磁磁界下における磁気ヒステリシス曲線の一例を示す図である。

【図5】本発明のFe族基非晶質金属薄帯において、励磁磁界下における磁気ヒステリシス曲線の一例を示す図である。

【図6】本発明の磁気マーカの一例を示す模式的な概略斜視図である。

【図7】失活状態を取り得る本発明の磁気マーカの一例を示す模式的な概略斜視図である。

【符号の説明】

- 1 Fe族基非晶質金属薄帯
- 2、3 基材フィルム
- 4 半硬質磁性材料

【図1】



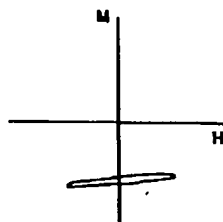
【図2】



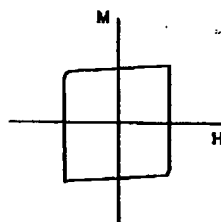
【図3】



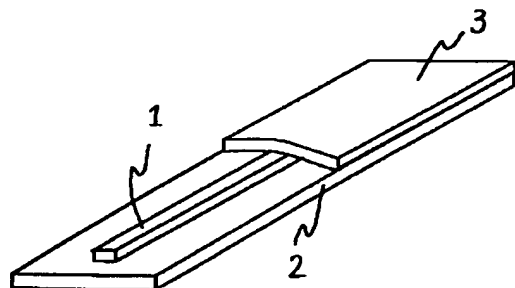
【図4】



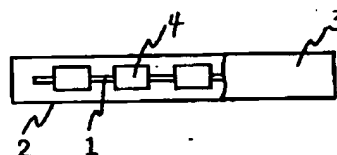
【図5】



【図6】



【図7】



## フロントページの続き

(31)優先権主張番号 特願平8-300088  
(32)優先日 平8(1996)11月12日  
(33)優先権主張国 日本(JP)  
(31)優先権主張番号 特願平9-16327  
(32)優先日 平9(1997)1月30日  
(33)優先権主張国 日本(JP)

(31)優先権主張番号 特願平9-16328  
(32)優先日 平9(1997)1月30日  
(33)優先権主張国 日本(JP)  
(31)優先権主張番号 特願平9-168377  
(32)優先日 平9(1997)6月25日  
(33)優先権主張国 日本(JP)  
(72)発明者 小笠原 勇  
京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株  
式会社中央研究所内